

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-149054

(43) Date of publication of application: 03.07.1987

(51)Int.CI.

G11B 7/26 C23C 14/34

(21)Application number: 60-289455

(71)Applicant: HITACHI MAXELL LTD

(22)Date of filing:

24.12.1985

(72)Inventor: KIKUCHI NAOYUKI

GOTO AKIRA IKEGAKI TETSUO

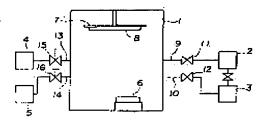
YAMAZAKI KATSUNOBU

# (54) MANUFACTURE OF OPTICAL INFORMATION RECORDING DISC AND SPUTTERING DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent adhesion of particles on a disc substrate by introducing a reducing gas in a discharge gas at vacuum deposition so as to prevent oxidation of target and arc discharge.

CONSTITUTION: A bell jar 1 is evacuated, argon, hydrogen gas are introduced from bombs 4, 5, and the disc substrate 8 on a counter electrode 7 is vapor—deposited from a target 6. Thus, the recording material for heat mode of the target 6 is not oxidized and no power is concentrated on atoms of the material, arc discharge is prevented to avoid defects in the recording film, the gases 4, 5 are supplied automatically in the bell jar 1 with a determined partial pressure so as to improve the practicability.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## ® 日本国特許庁(IP)

① 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 149054

@Int\_Cl.4

の出願

人

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和62年(1987)7月3日

G 11 B 7/26 C 23 C 14/34

8421 - 5D 6554 - 4K

審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

光情報記録ディスクの製造方法及びスパツタ装置 の発明の名称

> ②特 頤 昭60-289455

願 昭60(1985)12月24日 ②出

直 幸 池 ⑫発 明 者 砂発 明 眀 後 腇 者 哲 郎 ⑫発 明 者 生 垣 克 伸 明 山崎 73発 者

茨木市丑寅1丁目1番88号 日立マクセル株式会社内 茨木市丑寅1丁目1番88号 日立マクセル株式会社内

茨木市丑寅1丁目1番88号

茨木市丑寅1丁目1番88号 日立マクセル株式会社内 日立マクセル株式会社内

日立マクセル株式会社

茨木市丑寅1丁目1番88号

顯次郎 弁理士 武 ②代 理

### 呵 加 書

## 1. 発明の名称

光情観記録デイスクの製造方法及びスパッタ展置

- 2、特許請求の範囲
- (1) 放電ガスをイオン化してヒートモード用記録 材材にて形成されたターゲツトに射突させ、酸タ ーゲットからたたき出されるヒートモード用記録 材料の原子をディスク基板に蒸煮する光情報記録 ディスクの製造方法において、上記放電ガス中に 遠元性ガスを選入したことを特徴とする光情報記 師ディスクの製造方法。
- (2) 選元性ガスとして、水梨ガスを用いたことを 特徴とする特許請求の範囲第1項記載の光情報記 飯デイスクの風遊ガ法。
- (3) 放電ガスとして、ヘリウム、ネオン、アルゴ ン、クリプトン、キセノンから遺択された少なく とも1領数の不活性ガスを用いたことを特徴とす ろ特許請求の範囲第1項及び第2項記載の光情報 記録デイスクの製造方法。
- (4) デイスク基板及びターゲツトが収納されたべ

ルジヤに、真空ポンプと放電ガスポンペと選元性 ガスポンペとを逃殺し、上記真空ポンプを作助す ることによつて上記ペルジヤ内の真空皮が予じめ 定められた値に至つたとき、上記放電ガスポンペ 及び還元性ガスポンペから上記ペルジヤ内に予じ め定められた割合の放電ガス及び還元性ガスが供 絡されるようにしたことを特徴とするスパツタ装 間.

## 3. 発明の詳確な説明

〔磁藻上の利用分野〕

本発明は光情観記録デイスクの製造方法、より 詳しくは、ディスク結板にヒートモード用の配線 材料を形成する方法と、これに適用されるスパツ タ装置に関する。

## (従來の技術)

コンピュータ用光ディスクメモリなど、光エネ ルギを紙射することによつて辨報借号の追記を可 他にした光情和記録ディスクには、トラツキング 借号に対応するグループやアドレス信号に対応す るプリピットなど所定の凹凸パターンが形成され

### 特開明62-149054(2)

たディスク基板の当該凹凸パターン形成面に、ヒートモード用記録材料をもつて記録膜が形成されている。ディスク基板にかかる記録膜を形成する 事段としては、従来より操作が簡単で生遊性が良好であることから、一般に真空護療法またはDC (液流) スパッタ法が用いられている。

(発明が解決しようとする問題点)

然るに、真空蒸着法は高真空服に調整されたベルジヤ内において、蒸発物質をヒータにて加熱し、 蒸発した蒸発物質の原子虫たは分子をデイスク基 板に付着する神膜形成方法であるから、蒸発物質 が例えばTeSe合金など蒸発温度の異なる複数の 成分を含む場合、各成分の蒸発速度が異なるため にディスク基板上に均一な組成の記録膜が形成され れ難いという問題がある。

一方、 D C スパツタ法は、 グロー放電によつて イオン化された放電ガス原子をターゲットに射突 させ、 該ターゲットからたたき出されるターゲットの原子をディスク基板に蒸着する稼餓形成方法 であるから、 真空蒸着法の場合のような問題を有

### 【問題点を解決するための手段】

本語明は上記の知見に落づいてなされたものであって、スパッタ装置のベルジヤ内に供給された放電ガス中に例えば水滑ガスなどの選元性ガスを近入し、ターゲットの酸化を未然に防止することによってアーク放電の発生を防止し、もってディスク基板への粒子の付着を防止するようにしたことを特徴とするものである。

( 35 精 何 )

しない。しかしながら、例えばTeSe合金などのヒートモード用記録材料をターゲントとしてスパッタリングを行うと、数ターゲントと対向電極との間でアーク放電が生じ最く、火電流がターゲントの一部に局部的に集中してターゲントの一部が壊りとなって飛び出し、ディスク基板上に付着するという現象を生ずる。

アーク放性によりでは、 タット材料の塊りの、これでは、 でである。 ラットである。 デオディスクにこれが低いなを生じなが、 デオティスクには、上記の現象を生じなが、 を実用上ほとんど間壁がよっては、 といっては、 を生じなが、 も実出ータ用光ディスクにおいて、 のようにとがが、 を生じなが、 のようにとがが、 で変のように、 といっとしなが、 で変のように、 で変ののように、 で変したが、 で変した。 で変した。

以下、本発明に係る光情報記録デイスクの製造力法の一例を、第1回のフローチャートに基づいて説明する。

まず、ベルジヤ内にデイスク基板とヒートモード川記録材料にて作製されたターゲットを収納する(前1四(a))。

次いで、真空ポンプを駆動してベルジヤ内の空気を排出し、ベルジヤ内の真空底を予じめ定められた値に関盤する(第1図(b))。

其空度が所定の値に適した段階でベルジャ内に 放電ガス及び遠元性ガスを導入し、ベルジャ内の 放電ガスと遠元性ガスの混合ガスのガス圧を予じ め定められた値に刺盤する(第1回(c))。

次いで、上記ターゲットに直流電圧を印加し、 クーゲットと対向電極との間でグロー放電を起す ことによつてデイスク基板の凹凸パターン形成面 にターゲットを構成する材料の砂膜を形成する (第1回(d))。

尚、上記ターゲットとしては、Tc. Seなどの カルコゲン化合物のほか、Bi. Sn. 1n. 2n. Pb. Mg. Au. Ge. Ga. Sb. Rh. Mn. Alなど、公知に属する任意のヒートモード用記録材料及びこれらの合金または複合体を用いることができる。

また、上記放電ガスとしては、ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノンなどの不活 性ガスまたはこれらの混合ガスが用いられる。

また、上記還元性ガスとしては、水素、一酸化 炭素など任意の還元性ガスを用いることができる が、価格、安全性、還元性などの点から水浴ガス が最適である。

以下、具体的な実施例を掲げ、選元性ガスを総 入しないでスパンタリングを行つた場合との欠陥 レートを比較する。

#### 实施 医1

ベルジヤを 5 × 1 0 <sup>-6</sup> Torr まで裏空引きしたのち、ベルジヤ内にアルゴンガス及び水 異ガスを 導入し、ベルジヤ内のアルゴンガス分圧を 4 × 1 0 <sup>-3</sup> Torr 、水素ガス分圧を 1 × 1 0 <sup>-3</sup> Torr に関数した。ターゲットには、(-)350ボルト

上表から明らかなように、放電ガスとしてのアルゴンガス中に水素ガスを選入すると、記録膜の 欠陥レートが顕著に改著される。この場合、アルゴンガス分圧に対する水素ガス分圧の割合が高い ほど、即ち、水番ガスの混合量が多いほど記録膜 の欠陥レートが低下する傾向が見られた。

以下、上記光情報記録ディスクの製造方法に適用されるスパッタ装置の一例を約2回に基づいて 説明する。

このスパツタ装置は、ベルジヤ1と、 拡散ポンプ2と、メカニカルポンプ3と、アルゴンガスポンベ4と、水素ガスポンベ5とから主として構成されている。ベルジヤ1内には、ターゲツト6と対向電極7とが対向に配置されており、 設対向電板7にはデイスク基板8が取り付けられている。 位後ポンプ2及びメカニカルポンプ3とベルジンではではが登り、10にはそれぞれ井11、12が設定されており、管路9、10からベルジャ内に空気が侵入しないようになつている。また、アルゴンガスポンベ4及び水業ガスポンベ5とベ

の直流低圧を印加した。

#### 災施例 2

ベルジヤを 5 × 1 0 <sup>-6</sup> Torr まで真恋引きしたのち、ベルジヤ内にアルゴンガス及び水湖ガスを 個入し、ベルジヤ内のアルゴンガス分圧を 3 × 1 0 <sup>-3</sup> Torr 、水湖ガス分圧を 2 × 1 0 <sup>-3</sup> Torr に関盤した。程圧条件は上記実施例 1 の場合と同じである。

#### 比较例

ベルジヤを 5 × 1 0 <sup>-4</sup> Torr まで 真空引きしたのち、ベルジヤ内にアルゴンガスを導入し、ベルジヤ内のアルゴンガス分圧を 5 × 1 0 <sup>-3</sup> Torrに 調致した。電圧条件は上記実施例 1 の場合と同じである。

	欠陥レート
実施例 1	1.1×10-6
实施例 2	0.85×10-6
比較例	7 8 × 1 0 <sup>-6</sup>

ルジヤ1とを結ぶ管路13,14には、それぞれアルゴンガスポンベ4及び水素ガスポンベ5とベルジヤ1の芝圧によつて作動する圧力升15,16が設定されており、ベルジヤ1内の真空度がある予じめ定められた値になったとき、アルゴンガスポンベ5から上記芝圧に応じたアルゴンガス及び水素ガスがベルジヤ1内に自動的に供給されるようになつている。

上記実施例のスパッタ装置は、ベルジヤ1が予 じめ定められた真空度まで真空引きされたとき、 ベルジヤ1内に予じめ定められた分圧のアルゴン ガス及び水器ガスが自動的に供給されるようにし たので、操作が簡単で実用性が高いという特徴が ある。

尚、本発明の要旨は、スパッタ数置に還元性ガスポンペを付設した点に存するのであつて、 強圧によって作動する圧力外を設定することは必ずしも発明の要旨ではなく、 手動によつてベルジヤ内の放電ガス圧及び還元性ガス圧を開整するようにすることも勿論可能である。

## 特開昭62-149054(4)

#### 〔発明の効果〕

以上説明したように、本発明の光倍和記録デイスクの製造力法は、放電ガス中に遺元性ガスを犯入したので、たとえベルジャ内あるいはベルリしに収納されたデイスク基板中に空気が発いていたとしてもヒートモード用記録材料によって作型されたターゲットが酸化することがない、アーク技術の原子に対している。とができる。

また、予じめ定められた真空展まで真空引きされたとき、ベルジヤ内に予じめ定められた分圧の放電ガス及び遠元性ガスが自動的に供給されるようにしたので、実用性が高いという効果がある。
4. 図面の簡単な説明

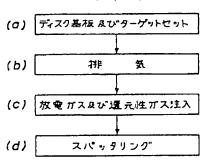
第1 図は本発明にかかる光情和記録デイスクの 製造方法を説明するフローチャートであり、第2 図は本発明にかかる光情報記録デイスクの製造方 法を英施するために用いられるスパッタ装置の斯 節図である。

1:ベルジヤ、2: 拡散ボンブ、3:メカニカルポンプ、4:アルゴンガスボンベ、5:水粉ガスボンベ、6:ターゲット、7:対向電極、8:ディスク基板、9,10:管路、11,12:逆止升、13,14:管路、15,16:圧力弁

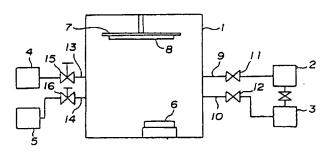
代理人非理士 武 额次部



## 第123



第2图



1:ベルジャ

5:水番ガスボンベ

2,3: ポンプ

6: ターゲット

4: アルゴンガスボンベ

8: ディスク基版